

### OMNI Point-of-Use Gas Purifier Systems



### FEATURES

ヒーターおよび電子アセンブリを備えた精製器  
コンパクト設計  
簡単操作  
不活性ガス、水素、酸性ガスおよび酸素から  
Sub-ppbレベルまでの不純物除去  
信頼と安全を兼ね備えた簡易操作の  
温度コントローラー  
連続的な加熱動作または室温動作を、  
その場でオペレーション可能

### APPLICATIONS

- 分析器（ゼロ/校正ガス）
- ガス分析カート
- プロセス装置
- 研究開発
- 半導体産業

NuPure™ Omniシリーズのポイント・オブ・ユース精製器システムには、Ultra PurePF/XLシリーズの精製器（フィルター）が内蔵されており、不活性ガス、水素、水素化合物、酸性ガス、酸素などから、Sub-ppbレベルまでガス不純物を低減することができます。PFシリーズには、0.003 μmのフィルター内蔵。Omniシリーズは、0～100slpmの流量範囲の製品ラインナップがあります。

NuPure™のOmniシリーズは、マニュアルIn/Exバルブおよびガス粒子フィルターなどを含む完全に統合されたシステムを低コストで提供致します。  
(バルブ、フィルターはオプションとなります。)

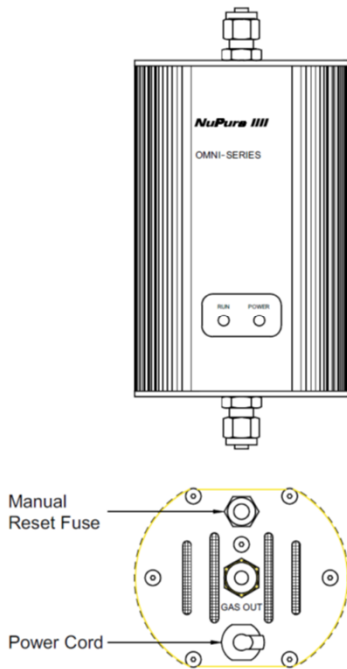
### LISTING OF GASES PURIFIED / FILTERED

Inert Gases		Hydrogen / Hydrides		Acid Gases	Oxygen
Impurities Removed H <sub>2</sub> O, O <sub>2</sub> , CO, CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> <sup>1</sup> (N <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> ) <sup>2</sup>		Impurities Removed H <sub>2</sub> O, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO, (N <sub>2</sub> ) <sup>3</sup>		Impurities Removed H <sub>2</sub> O	Impurities Removed H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , (H <sub>2</sub> , CO, CH <sub>4</sub> ) <sup>4</sup>
Ar	Ar/CH <sub>4</sub>	H <sub>2</sub>	AsH <sub>3</sub>	HBr	O <sub>2</sub>
He	CH <sub>4</sub>	Ar/H <sub>2</sub>	PH <sub>3</sub>	HCl	Air
Ne	CF <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> /H <sub>2</sub>	NH <sub>3</sub>	BCl <sub>3</sub>	N <sub>2</sub> O
Kr	CCl <sub>4</sub>	SiH <sub>4</sub>	B <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	BF <sub>3</sub>	
Xe	SF <sub>6</sub>	Si <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	H <sub>2</sub> Se	Cl <sub>2</sub>	
N <sub>2</sub>	Freons	D.C.S.	GeH <sub>4</sub>	HF	

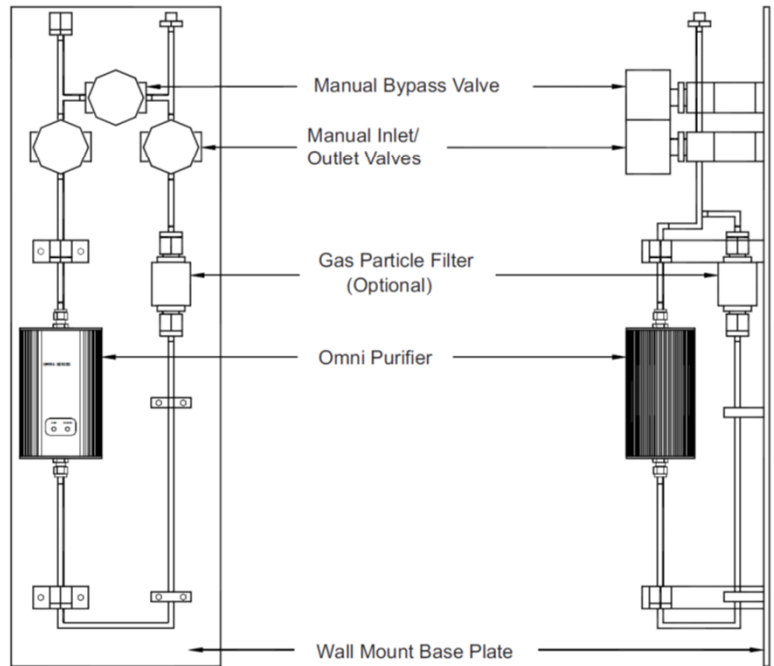
1: Hモデルを選択した場合のみ。  
2: ヒートゲッターを使用して、He/Ne/Ar/Kr/Xe/Nのみから除去可能な追加の不純物。  
3: ヒートゲッターを使用して、水素のみから除去可能な追加の不純物。  
4: オプションの加熱触媒を選択した場合のみ。

# NuPure™ Omni Series Point-of-Use Purifier

## Technical Specification



Omni Series Purifier Module



Omni Series Purifier System

Model	Average Flows (slpm) <sup>1</sup> for 1 year lifetime (removal of impurities per chart page 1)	Max Flow (slpm) @ 150 psig (Heated)	Voltage	115/240 V AC
Omni 40	0.3	1.5	Housing	Extruded Aluminium 6063
Omni 100	1	5	Maximum Pressure	250 psig/9.9 kg/cm <sup>2</sup> G (Japan)
Omni 200	2	10	Operating Temperature	375°C - 450°C
Omni 600	6	30	Leak Rate	< 2 x 10 <sup>-10</sup> atm cc/sec He
Omni 1000	10	50	Materials (Purifier)	316L S.S. (< 10Ra)
Omni 2000	20	100	Fittings	1/4" VCR <sup>2</sup> / Compression
			Gas Inlet	VLSI grade (99.9995%)

1: 寿命は入口ガス不純物レベルと平均流量に反比例します。寿命については、ゲッター精製器で、H<sub>2</sub>OとO<sub>2</sub>の除去の為だけに使用して約4年です(規定のガスレベル及び流量で使用した場合)。

2: VCR互換規格。VCRはCajon社の登録商標です。

株式会社 エムアイティ  
 東京都町田市旭町1-7-5 エンゼルビル1F  
 :042-710-3780 Fax:042-727-2749  
 E-mail: [yuya@mit-co.com](mailto:yuya@mit-co.com) URL: <http://www.mit-co.com>

Or Contact :